

## ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ И ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ КРИСТАЛЛОВ $\text{BiF}_3$

© 2023 г. Н. И. Сорокин<sup>1,\*</sup>, Д. Н. Каримов<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Институт кристаллографии им. А. В. Шубникова ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН, Москва, Россия

\* E-mail: nsorokin1@yandex.ru

Поступила в редакцию 21.11.2022 г.

После доработки 21.11.2022 г.

Принята к публикации 25.11.2022 г.

Исследованы температурная зависимость ионной электропроводности  $\sigma_{dc}(T)$  и термическая стабильность кристаллов  $\text{BiF}_3$  со структурой ромбического  $\beta\text{-YF}_3$  (пр. гр.  $Pnma$ ,  $a = 6.5620(1)$ ,  $b = 7.0144(1)$ ,  $c = 4.8410(1)$  Å,  $V/Z = 55.71$  Å<sup>3</sup>), выращенных из расплава методом вертикальной направленной кристаллизации. Электрофизические характеристики  $\text{BiF}_3$  получены из импедансных измерений в интервале температур 360–540 К. Значение  $\sigma_{dc}$  при  $T = 500$  К и энталпия активации ионного переноса  $\Delta H_a$  равны  $2.5 \times 10^{-5}$  См/см и  $0.48 \pm 0.05$  эВ соответственно. Величина  $\Delta H_a$  для изученного кристалла меньше в 1.4 раза по сравнению с изоструктурными редкоземельными (Tb, Ho, Er, Y) трифторидами, что обусловлено высокой электронной поляризуемостью и большим ионным радиусом катионов  $\text{Bi}^{3+}$ . Обнаружено, что кристаллы  $\text{BiF}_3$  термически стабильны до 550–600 К, при более высоких температурах они деградируют из-за сублимации вещества и пирогидролиза. Образование оксифторидных фаз  $\text{BiO}_x\text{F}_{3-2x}$  является причиной наблюдаемого скачка проводимости на зависимости  $\sigma_{dc}(T)$  при  $T \sim 600$  К.

DOI: 10.31857/S0023476123020182, EDN: BSTFGF

### ВВЕДЕНИЕ

Трифторид висмута  $\text{BiF}_3$  и материалы на его основе относятся к фторпроводящим твердым электролитам с высокой унипольярной анионной электропроводностью [1–3]. Особенно активно они применяются в качестве основных компонентов электродных композиций во фтор-ионных источниках тока [4–8]. При нормальном давлении это соединение во всем температурном интервале существования имеет структуру типа ромбической модификации  $\beta\text{-YF}_3$  (пр. гр.  $Pnma$ ,  $Z = 4$ ) [9]. Катионы  $\text{Bi}^{3+}$  окружены восемью ближайшими анионами  $\text{F}^-$  на расстояниях 2.22–2.50 Å, девятый анион  $\text{F}^-$  находится на расстоянии 3.10 Å (координационное число для  $\text{Bi}^{3+}$  принимают равным 9). Такое искажение координационного полизэдра катионов  $\text{Bi}^{3+}$  объясняется наличием у них стереохимически активной неподеленной пары  $6s^2$ -электронов.

Сведения о кубической модификации  $\text{BiF}_3$  [10–12] оказались ошибочными, ей соответствует высокотемпературная кубическая модификация оксофторида  $\text{BiOF}$  [13]. С повышением давления происходит полиморфный фазовый переход ромбической модификации  $\text{BiF}_3$  в тригональную

структуре тисонита (пр. гр.  $P\bar{3}c1$ ,  $Z = 6$ ) [14]. Тисонитоподобной структурой также обладает оксифторидная фаза  $\text{BiO}_x\text{F}_{3-2x}$  ( $x \leq 0.1$ ).

Традиционно трифторид висмута рассматривают как легкоплавкий аналог изоструктурных ему соединений редкоземельных элементов (РЗЭ)  $RF_3$  ( $R = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}$ ) и низкотемпературных  $\beta$ -модификаций  $RF_3$  ( $R = \text{Er}, \text{Tm}, \text{Yb}, \text{Lu}, \text{Y}$ ). В отличие от редкоземельных катионов  $R^{3+}$  катионы  $\text{Bi}^{3+}$  обладают высокой электронной поляризуемостью из-за наличия неподеленной пары  $6s^2$ -электронов. Легкая деформируемость электронной оболочки  $\text{Bi}^{3+}$  определяет высокую диэлектрическую проницаемость и низкую температуру плавления ( $T_{\text{fus}}$ ) кристаллов  $\text{BiF}_3$ . Приведенные в литературе значения  $T_{\text{fus}}$  сильно различаются между собой: 928 [15], 993 [11], 1018 [16], 1030 [9, 17] К. Значения  $T_{\text{fus}}$  соединений  $RF_3$  ( $R = \text{Tb}–\text{Lu}, \text{Y}$ ) значительно выше и составляют 1440–1455 К [18, 19].

При работе с трифторидом висмута и материалами с его участием возникают значительные экспериментальные трудности, поскольку он имеет высокое давление паров и гидролизуется легче многих известных фторидов металлов, что приводит к кислородному загрязнению. Образо-

вание оксофторидов часто принимали за полиморфные переходы в  $\text{BiF}_3$  [9]. Похожая ситуация наблюдалась для изоструктурных трифтторидов РЗЭ  $RF_3$  ( $R = \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}$ ): внедрение кислорода в их структуру приводит к мнимому “диморфизму” [20]. Повышенная склонность трифтторида висмута к реакции пирогидролиза находит применение для количественного определения методами рентгенофазового анализа глубины протекания пирогидролиза (предел детектирования кислорода не менее 100 ppm) во фторидах других металлов при их термической обработке [21].

Электрофизические свойства поликристаллических образцов  $\text{BiF}_3$  изучались ранее в [17, 22]. На температурной зависимости анионной проводимости обнаружен скачок проводимости при  $T \sim 600$  К, природа которого не объясняется [22]. Поэтому для практических применений важно установить область термической стабильности кристаллов трифтторида висмута.

Цель работы – исследование анионной проводимости и термической стабильности объемных кристаллов  $\text{BiF}_3$ , сравнение полученных электрофизических характеристик с данными для изоструктурных  $RF_3$ .

## ЭКСПЕРИМЕНТ

Кристаллы  $\text{BiF}_3$  получены из расплава вертикальной направленной кристаллизацией по методу Бриджмена. Безводный трифтторид висмута получали взаимодействием  $\text{Bi}_2\text{O}_3$  (99.9%, Химкрафт, Россия) и  $\text{NH}_4\text{F}$  особой чистоты с последующей термической обработкой в вакууме. Выращивание кристаллов осуществлялось методом вертикальной направленной кристаллизации в двухзонной ростовой установке с графитовым тепловым узлом, методика подробно описана в [23]. В качестве активной фторирующей атмосферы использовали высокочистый  $\text{CF}_4$ . Применили графитовый тигель специальной конструкции, позволяющей снизить потери реагента на испарение, которые не превышали 2 мас. %.

Рентгенофазовый анализ проводили на порошковом дифрактометре Rigaku MiniFlex 600 (излучение  $\text{Cu}K_\alpha$ ) в диапазоне углов  $2\theta = 10^\circ - 100^\circ$ . Идентификацию фаз осуществляли с использованием базы данных ICDD PDF-2 (2014). Расчет параметров элементарной ячейки проводили методом полнопрофильного анализа Ритвельда с использованием программного обеспечения X'Pert HighScore Plus (PANalytical).

Статическую электропроводность  $\sigma_{dc}$  на постоянном токе кристалла  $\text{BiF}_3$  определяли методом импедансной спектроскопии (прибор Tesla BM-507, диапазон частот  $5 - 5 \times 10^5$  Гц). Образец представлял собой диск диаметром 12 мм и тол-

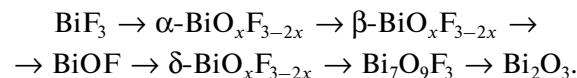
щиной 2.2 мм. В качестве электродов использовали серебряную пасту Leitsilber. Импедансные измерения проводили в вакуумной ( $\sim 10^{-1}$  Па) кондуктометрической установке [24] в диапазоне  $T = 360 - 750$  К.

## ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Изучаемые кристаллы  $\text{BiF}_3$  принадлежат структурному типу  $\beta\text{-YF}_3$  (пр. гр.  $Pnma$ ) (рис. 1). Параметры ромбической элементарной ячейки и формульного объема равны  $a = 6.5620(1)$ ,  $b = 7.0144(1)$ ,  $c = 4.8410(1)$  Å,  $V/Z = 55.71$  Å<sup>3</sup> и близки к данным [9, 25, 26].

В кондуктометрических измерениях обнаружено, что при нагревании, начиная с  $T = 550$  К, наблюдается деградация кристаллов. После цикла нагрева в образцах фиксируются следы оксофторидных фаз (моноклинной, тетрагональной и ромбической) с разным соотношением O/F (рис. 1):  $\text{Bi}_7\text{O}_5\text{F}_{11}$  (PDF # 50-0003),  $\text{BiOF}$  (PDF # 73-1595),  $\text{Bi}_{1.2}\text{O}_{0.6}\text{F}_{2.4}$  (PDF # 36-0457).

Процессы деградации кристаллического образца вызваны, по-видимому, совместным действием частичного пирогидролиза, приводящего к образованию оксофторидов висмута, и сублимации вещества (массовые потери превышают 25 мас. %). Наблюданное термическое поведение  $\text{BiF}_3$  подтверждается результатами исследований [13, 15, 25]. По данным [25] пирогидролиз  $\text{BiF}_3$  начинается при  $T \geq 513$  К и протекает в последовательности [13, 27]:



Температурная зависимость анионной проводимости кристалла  $\text{BiF}_3$  в аррениусовых координатах ( $\lg \sigma_{dc}$ ,  $10^3/T$ ) показана на рис. 2а. Для сравнения приведены электрофизические данные для поликристаллических образцов  $\text{BiF}_3$  [17, 22] и ряда оксифторидов [3, 28]. Полученные результаты подтверждают существование скачка проводимости при  $T \sim 600$  К на зависимости  $\sigma_{dc}(T)$  для трифтторида  $\text{BiF}_3$ , ранее обнаруженного в [22]. При охлаждении кондуктометрические данные не воспроизводятся. Совместный анализ имеющихся электрофизических, термических и кристаллохимических данных позволяет сделать вывод, что наблюдаемый скачок проводимости не связан с полиморфизмом трифтторида висмута. Его причиной является деградация кристаллов  $\text{BiF}_3$  [15, 25].

Математическую обработку кондуктометрических данных кристалла  $\text{BiF}_3$  проводили в области его термической стабильности при нагревании ( $T < 550$  К). В температурном интервале 360–540 К

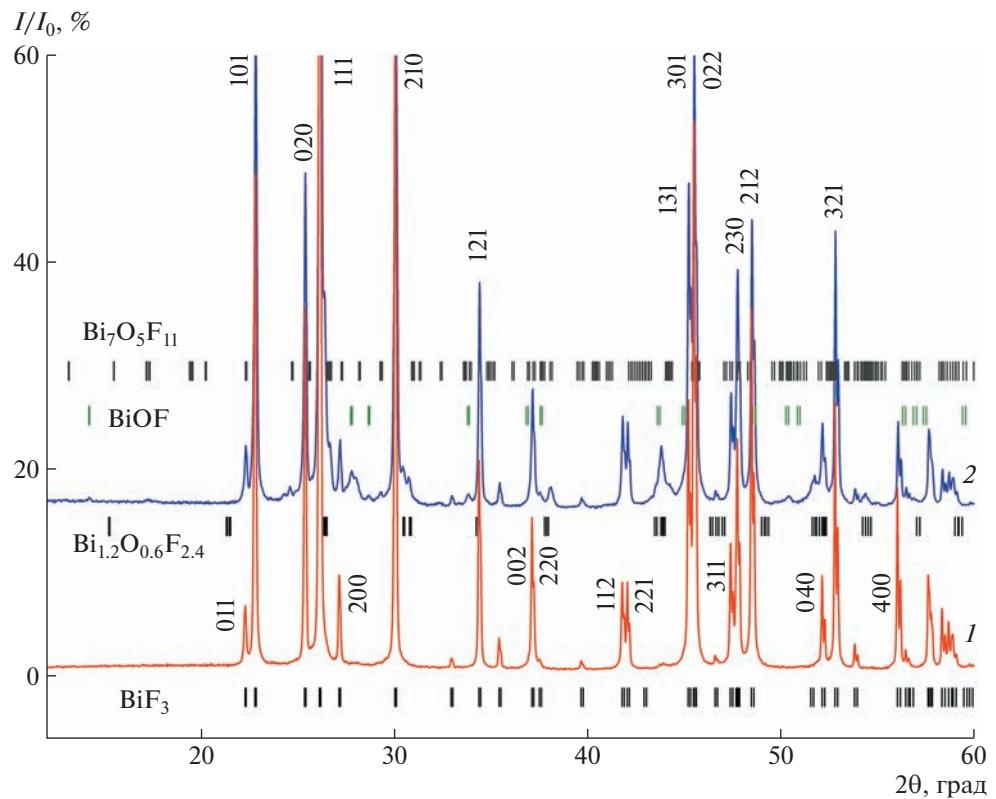


Рис. 1. Дифрактограммы исходного кристалла  $\text{BiF}_3$  (1) и образца после нагрева (2). Показаны положения рефлексов Брэгга для указанных соединений.

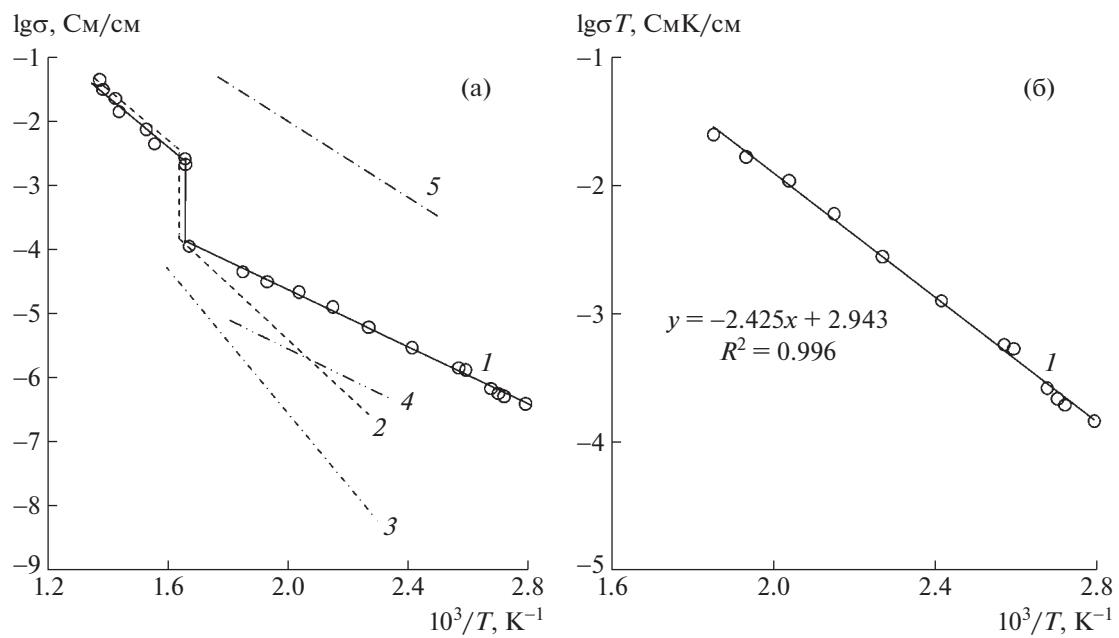


Рис. 2. Температурные зависимости анионной проводимости кристаллов  $\text{BiF}_3$  в координатах Аррениуса ( $\lg \sigma$ ,  $10^3/T$ ) (а) и Аррениуса–Френкеля ( $\lg \sigma_{dc}T$ ,  $10^3/T$ ) в области термической стабильности кристалла (360–540 К) (б): 1 – настоящая работа, 2 – [22], 3 – [17]. Для сравнения приведены данные для оксофторидов висмута: 4 –  $\text{BiOF}$  (тетрагональная модификация) [28], 5 –  $\text{BiO}_{0.1}\text{F}_{2.8}$  (тисонитовый твердый раствор) [3].

**Таблица 1.** Структурные, термические и электрофизические характеристики изоструктурных трифтторидов Bi, Tb, Ho, Er и Y

Кристалл	Параметры решетки, Å			$T_{\text{fus}}$ , K	Проводимость	
	$a$	$b$	$c$		$\sigma_{500 \text{ K}}, 10^{-6} \text{ См}/\text{см}$	$\Delta H_a, \text{эВ}$
BiF <sub>3</sub>	6.5620	7.0144	4.8410	1030 [9, 17]	25	0.48
TbF <sub>3</sub> *	6.5079	6.9455	4.3869	1439 [18], 1455 [19]	8 [28]	0.61 [29]
HoF <sub>3</sub> *	6.4038	6.8734	4.3777	1413 [18], 1420 [19]	5 [29]	0.74 [30]
$\beta$ -ErF <sub>3</sub> *	6.3489	6.8417	4.3824	1407 [18], 1420 [19]	1 [30]	0.71 [31]
$\beta$ -YF <sub>3</sub> *	6.4027	6.8843	4.3980	1425 [18]	2 [31]	0.70 [32]

\* Параметры решетки трифтторидов РЗЭ взяты из [33].

значения  $\sigma_{dc}$  изменяются от  $4.1 \times 10^{-7}$  до  $4.6 \times 10^{-5} \text{ См}/\text{см}$  (в  $\sim 10^2$  раз). Температурная зависимость анионной проводимости кристалла BiF<sub>3</sub> в координатах Аррениуса–Френкеля  $\lg \sigma_{dc} T, 10^3/T$  приведена на рис. 2б.

Зависимость  $\sigma_{dc} = f(T)$  удовлетворяет уравнению

$$\sigma_{dc} T = A \exp(-\Delta H_a/kT),$$

где  $A$  – предэкспоненциальный множитель,  $\Delta H_a$  – энталпия активации ионного транспорта. Значения  $A$  и  $\Delta H_a$  равны  $8.8 \times 10^2 \text{ СмК}/\text{см}$  и  $0.48 \pm 0.05 \text{ эВ}$  соответственно. При 500 K объемная проводимость монолитного образца BiF<sub>3</sub> равна  $2.5 \times 10^{-5} \text{ См}/\text{см}$  и значительно превышает абсолютные значения электропроводности керамических образцов  $3 \times 10^{-7} \text{ См}/\text{см}$  [17] и  $3 \times 10^{-6} \text{ См}/\text{см}$  [22]. Этот факт связан с тем, что на величину проводимости поликристаллических образцов, полученных по традиционной керамической технологии, оказывают сильное влияние межзеренные границы.

Представляет интерес сравнить структурные, термические и электрофизические характеристики ромбических трифтторидов Bi и РЗЭ со структурой типа  $\beta$ -YF<sub>3</sub>. Параметры решетки, температуры плавления, фтор-ионная проводимость при 500 K и энталпия ее активации для изоструктурных фтористых соединений BiF<sub>3</sub> и RF<sub>3</sub> ( $R = \text{Tb}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Y}$ ) приведены в табл. 1. Можно видеть, что абсолютные значения  $\sigma_{dc}$  этих кристаллов различаются незначительно. Тогда как энталпия активации анионного переноса в BiF<sub>3</sub> меньше в  $1.4 \pm 0.1$  раза соответствующих характеристик трифтторидов РЗЭ.

Снижение величины энталпии  $\Delta H_a$  в трифтториде висмута обусловлено двумя факторами. Во-первых, высокая электронная поляризуемость катионов Bi<sup>3+</sup> (наличие у них неподеленной электронной пары) ослабляет кулоновское взаимодействие между катионами и анионами, пони-

жающая потенциальные барьеры для прыжкового движения анионов F<sup>-</sup> по структурным позициям. Во-вторых, ионный радиус катиона Bi<sup>3+</sup> (1.31 Å [34]) существенно превышает размеры катионов Tb<sup>3+</sup>, Ho<sup>3+</sup>, Er<sup>3+</sup> и Y<sup>3+</sup> (1.144–1.180 Å), что значительно увеличивает свободный объем в кристаллической структуре BiF<sub>3</sub> для миграции анионов F<sup>-</sup>.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ромбические кристаллы BiF<sub>3</sub> получены из расплава методом направленной кристаллизации. Кристаллы являются стабильными при температуре до 550–600 K как в инертной атмосфере, так и в вакууме. Причинами потери стабильности являются повышенная склонность к пирогидролизу и высокая упругость паров трифтторида висмута.

Скачок проводимости при  $T \sim 600$  K на зависимости  $\sigma_{dc}(T)$  при нагревании связан с деградацией образцов. В области термической стабильности (360–540 K) анионная проводимость кристалла BiF<sub>3</sub> удовлетворяет уравнению Аррениуса–Френкеля. Величина анионной проводимости при 500 K составляет  $\sigma_{dc} = 2.5 \times 10^{-5} \text{ См}/\text{см}$ , энталпия активации фтор-ионного транспорта равна  $\Delta H_a = 0.48 \pm 0.05 \text{ эВ}$ .

Проведен сравнительный анализ электрофизических характеристик изоструктурных трифтторидов Bi и РЗЭ (Tb, Ho, Er и Y). Энталпия активации анионного переноса в BiF<sub>3</sub> по сравнению с редкоземельными трифтторидами меньше в  $1.4 \pm 0.1$  раза. Уменьшение энталпии активации анионного транспорта (барьеров потенциального рельефа для прыжкового движения анионов фтора) вызвано наличием неподеленной электронной пары у катиона Bi<sup>3+</sup> и его большим ионным радиусом по сравнению с катионами РЗЭ R<sup>3+</sup>.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках выполнения работ по Государственному заданию

ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН с использованием оборудования Центра коллективного пользования ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кавун В.Я., Уваров Н.Ф., Слободюк А.Б. и др. // Изв. РАН. Сер. хим. 2022. № 6. С. 1059.
2. Слободюк А.Б., Полянцев М.М., Гончарук В.К., Кавун В.Я. // Вестн. ДВО РАН. 2021. № 5. С. 95.
3. Сорокин Н.И., Соболев Б.П. // Электрохимия. 2011. Т. 47. № 1. С. 118.
4. Baumgartner J.F., Krumeich F., Worle M. et al. // Commun. Chem. 2022. V. 5. P. 6. <https://doi.org/10.1038/s42004-021-00622-y>
5. Liu T., Peng N., Zhang X. et al. // Energy Storage Mater. 2021. V. 42. P. 42. <https://doi.org/10.1016/j.ensm.2019.03.028>
6. Xiao A.W., Galatolo G., Pasta M. // Joule. 2021. V. 5. № 11. P. 2823. <https://doi.org/10.1016/j.joule.2021.09.016>
7. Konishi H., Minato T., Abe T., Ogumi Z. // Chemistry-Select. 2020. V. 5. № 21. P. 4943. <https://doi.org/10.1002/slct.202001163>
8. Gschwind F., Rodriguez-Garcia G., Sandbeck D.J.S. et al. // J. Fluor. Chem. 2016. V. 182. P. 76. <https://doi.org/10.1016/j.jfluchem.2015.12.002>
9. Greis O., Martinez-Ripoll M. // Z. Anorg. Allg. Chem. 1977. B. 436. № 1. S. 105. <https://doi.org/10.1002/zaac.19774360112>
10. Yang Z., Pei Y., Wang X. et al. // Comput. Mater. Sci. 2013. V. 68. P. 117. <https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2012.10.003>
11. Kim K.J., Yoshimura M., Somiya S. // Solid State Ionics. 1991. V. 44. № 3–4. P. 281. [https://doi.org/10.1016/0167-2738\(91\)90019-8](https://doi.org/10.1016/0167-2738(91)90019-8)
12. Croatto U. // Z. Anorg. Allg. Chem. 1949. B. 258. № 3–5. S. 198. <https://doi.org/10.1002/zaac.19492580310>
13. Ardashnikova E.I., Prituzhalov V.A., Kutsenok I.V. // Functionalized Inorganic Fluorides: Synthesis, Characterization and Properties of Nanostructured Solids / Ed. Tressaud A. Chichester: John Wiley, 2010. P. 423. <https://doi.org/10.1002/9780470660768.ch14>
14. Ардашникова Е.И., Борзенкова М.П., Калинченко Ф.В., Новоселова А.В. // Журн. неорган. химии. 1981. Т. 26. № 7. С. 1727.
15. Nakamura G.H.G., Klimm D., Baldochi S.L. // Thermochim. Acta. 2013. V. 551. P. 131. <https://doi.org/10.1016/j.tca.2012.10.005>
16. Pastor R.C., Harrington J.A., Gorre L.E., Chew R.K. // Mater. Res. Bull. 1979. V. 14. № 4. P. 543. [https://doi.org/10.1016/0025-5408\(79\)90198-3](https://doi.org/10.1016/0025-5408(79)90198-3)
17. Shafer M.W., Chandrashekhar G.N., Figat R.A. // Solid State Ionics. 1981. V. 5. P. 633. [https://doi.org/10.1016/0167-2738\(81\)90334-9](https://doi.org/10.1016/0167-2738(81)90334-9)
18. Spedding F.H., Beaudry B.J., Henderson D.C., Moorman J. // J. Chem. Phys. 1973. V. 60. № 4. P. 1578. <https://doi.org/10.1063/1.1681233>
19. Greis O., Cader M.S.R. // Thermochim. Acta. 1985. V. 87. № 1. P. 145. [https://doi.org/10.1016/0040-6031\(85\)85329-6](https://doi.org/10.1016/0040-6031(85)85329-6)
20. Thoma R.E., Brunton G.D. // Inorg. Chem. 1966. V. 5. № 11. P. 1937. <https://doi.org/10.1021/ic50045a022>
21. Ардашникова Е.И., Борзенкова М.П., Новоселова А.В., Свищев И.М. // Журн. неорган. химии. 1986. Т. 31. № 2. С. 513.
22. Иванов-Шиц А.К., Мурин И.В. Ионика твердого тела. Т. 2. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010. 1000 с.
23. Каримов Д.Н., Бучинская И.И., Дымшиц Ю.М. и др. // Патент RU 2778808, 25.08.2022.
24. Иванов-Шиц А.К., Сорокин Н.И., Федоров П.П., Соболев Б.П. // ФТТ. 1983. Т. 25. № 6. С. 1748.
25. Калинченко Ф.В. // //Дисс. канд. хим. наук. М.: МГУ. 1982. 203 с.
26. Cheetham A.B., Norman N. // Acta Chem. Scand. A. 1974. V. 28. P. 55.
27. Виноградова-Жаброва А.С., Сивцова О.В., Патрушева В.Г., Бамбуров В.Г. // Журн. неорган. химии. 2001. Т. 46. № 2. С. 274.
28. Matar S., Reau J.-M., Rabardel L. et al. // Solid State Ionics. 1983. V. 11. № 1. P. 77. [https://doi.org/10.1016/0167-2738\(83\)90066-8](https://doi.org/10.1016/0167-2738(83)90066-8)
29. Сорокин Н.И., Каримов Д.Н., Соболев Б.П. // Кристаллография. 2019. Т. 64. № 4. С. 596. <https://doi.org/10.1134/S0023476119040222>
30. Сорокин Н.И., Соболев Б.П., Брайтер М. // ФТТ. 2002. Т. 44. № 2. С. 272.
31. Trnovcová V., Fedorov P.P., Valkovskii M.D. et al. // Ionics. 1997. V. 3. P. 313. <https://doi.org/10.1007/BF02375637>
32. Трновцова В., Федоров П.П., Соболев Б.П. и др. // Кристаллография. 1996. Т. 41. № 4. С. 731.
33. Greis O., Petzel T. // Z. Anorg. Allg. Chem. 1974. B. 403. № 1. S. 1. <https://doi.org/10.1002/zaac.19744030102>
34. Shannon R.D. // Acta Cryst. A. 1976. V. 32. № 5. P. 751. <https://doi.org/10.1107/S056773947600155>